

2024年1月26日

各 位

JX金属株式会社

組織改正について

JX金属株式会社（社長：林 陽一、以下「当社」）は、新規事業分野の育成推進のため、本年2月1日付で「技術本部技術戦略部」内に「CVD・ALD 材料事業推進室」を設置いたします。

半導体製造プロセス向けの材料市場は、今後も高い成長が見込まれています。当社主力製品のひとつである半導体用スパッタリングターゲットは、半導体チップの薄膜を形成するPVD（※1）に用いられ、顧客から高い評価を受けて世界トップの市場シェアを有しています。今後半導体の微細化や多層化がさらに進んでいく中で、スパッタリング法に加えて、CVD・ALD（※2）による薄膜形成のニーズも高まることが見込まれています。当組織では、次世代半導体向けCVD・ALD材料の開発テーマ探索から量産化までを一貫して担い、早期事業化を推進してまいります。

以 上

※1 PVD：Physical Vapor Deposition(物理気相成長法)の略。スパッタリング法は代表的なPVDプロセスのひとつ。

※2 CVD：Chemical Vapor Deposition(化学気相成長法)の略。化学反応を活用して薄膜を形成する方法。

ALD：Atomic Layer Deposition(原子層積層法)の略。原子層レベルで膜厚を制御して薄膜を形成する方法。

